

# 小型スパッタ装置

研究開発装置 EB1000 / 生産装置 EB1100, EC7000

## EB1000

### 研究開発向け装置



- ・カソードサイズ×数  
 $\phi 2'' \times 3$ 基
- ・成膜有効エリア  
 $\phi 100$  mm



スパッタ室

装置構成

## EB1100

### 研究開発・生産向け装置



- ・カソードサイズ×数  
 $\phi 4'' \times 4$ 基 (標準3基)  
 $\phi 12.5'' \times 1$ 基
- ・成膜有効エリア  
 $\phi 220$  mm



スパッタ室

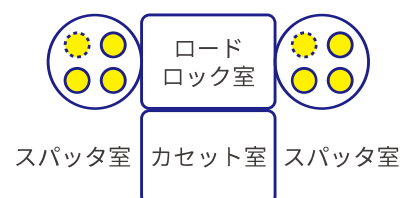
装置構成

## EC7000/7001

### 生産向け装置



- ・カソードサイズ×数  
 $\phi 4'' \times 4$ 基 (標準3基)  
 $\phi 12.5'' \times 1$ 基
- ・成膜有効エリア  
 $\phi 220$  mm
- ・カセット室・トランスファ室装備
- ・スパッタ室を2室装備 (EC7001)



装置構成